© EPODOC / EPO

- PN JP2001181386 A 20010703
- TI COMPOSITION CATIONICALLY CURABLE BY ACTIVE ENERGY RAY
- FI C08G65/18; C08G65/22; C09D4/00; C09D5/00&C; C09D171/02
- PA TOAGOSEI CO LTD
- IN SASAKI YUTAKA; KATO HISAO; KURIYAMA AKIRA
- AP JP19990372651 19991228
- PR JP19990372651 19991228
- DT -I

© WPI / DERWENT

- AN 2001-539147 [60]
- TI Active energy ray-cation-setting composition, quickly polymerizing with active energy ray for a short time
- AB JP2001181386 NOVELTY An active energy ray cation-setting composition comprises (A) exetane compound and (B) a compound which initiates cation-polymerization by exposing to active energy ray.
 - DETAILED DESCRIPTION An active energy ray cation-setting composition comprises (A) oxetane compound of formula (1-1) and (B) a compound which initiates cation-polymerization by exposing to active energy ray.
 - R1, R2 = H, F, 1-6C alkyl, 1-6C fluoroalkyl, allyl, aryl or furyl;
 - R3-R7 = H, 1-6C alkyl or 1-6C alkoxy.
 - USE The composition is suitable for coatings, paints, film, sheet-form material, molding material and
 - ADVANTAGE The active energy ray-cation-setting type composition quickly polymerizes by exposing to active energy ray for a short time and has good adhesion.
 - -(Dwa.0/0)
- IW ACTIVE ENERGY RAY CATION SET COMPOSITION QUICK ACTIVE ENERGY RAY SHORT TIME
- PN JP2001181386 A 20010703 DW200160 C08G65/18 007pp
- C08G65/18; C08G65/22; C09D4/00; C09D5/00; C09D171/02
- MC A02-A09 A05-H01 G02-A02B2 G02-A05 G03-B02E
- DC A81 A82 G02 G03
- PA (TOAG) TOA GOSEI CHEM IND LTD
- AP JP19990372651 19991228
- PR JP19990372651 19991228

© PAJ / JPO

- PN JP2001181386 A 20010703
- TI COMPOSITION CATIONICALLY CURABLE BY ACTIVE ENERGY RAY
- PROBLEM TO BE SOLVED: To provide compositions cationically curable by active energy rays which are quickly polymerized by irradiation with active energy rays in a short period of time without using a compound having an oxirane ring.
 - SOLUTION: The compositions cationically curable by active energy rays comprise (A) an oxetane compound represented by the formula (wherein R1 and R2 are each a hydrogen atom, a fluorine atom, a 1-6C alkyl group, a 1-6C fluoroalkyl group, an allyl group, an aryl group or a furyl group; and R3-R7 are each a hydrogen atom, a 1-6C alkyl group or a 1-6C alkoxy group) and (B) a compound which initiates cationic polymerization by irradiation with active energy rays.
 - C08G65/18 ; C08G65/22
- si C09D4/00 ; C09D5/00 ; C09D171/02
- PA TOAGOSEI CO LTD
- IN KATO HISAO;SASAKI YUTAKA;KURIYAMA AKIRA
- ABD 20010511
- ABV 200024
- AP JP19990372651 19991228

-

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] An activity energy line cation hardening mold constituent which consists of an oxetane compound (A) expressed with the following formula (1), and a compound (B) which makes cationic polymerization start by the exposure of an activity energy line.

$$\begin{array}{c|c}
 & R^{2} & R^{3} & R^{4} \\
\hline
 & R^{7} & R^{6}
\end{array}$$

(R1 and R2 show a hydrogen atom, a fluorine atom, the alkyl group of 1-6 carbon numbers, the fluoro alkyl group of 1-6 carbon numbers, an allyl group, an aryl group, or a furil radical among a formula, respectively.) R3-R7 show a hydrogen atom, the alkyl group of 1-6 carbon numbers, or the alkoxy group of 1-6 carbon numbers, respectively.

[Claim 2] An activity energy line cation hardening mold constituent containing a compound which has (C) oxetane ring other than said component (A) and said component (B) further according to claim 1.

[Claim 3] An activity energy line cation hardening mold constituent according to claim 1 or 2 said whose components (A) are 2-(4-methoxypheny)-3 expressed with the following type (2), and 3-dimethyl oxetane.

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 OCH_3 (2)

[Translation done.]

				4	.4)		ŕ
				green of the second			
		*	·				
**			en e				
				-			
				us _e			
			•	***		•	
			•			•	
	· ·				, e.e.		
						et la	
		and the second s				د روي اور ^د ا	e, .
				4			á
		•			2	ing the second s	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A STATE OF S	
				t e		* 24	
					The state of the s		
						√ ·	
			•	of Administration			
				4.		**	
					*		
	and the second s		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	e es	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*** **********************************	· (4)	** **	78° c		
		in the second se				the state of	
• *				Special Control of the Control of th			
					•		
			+ 3 - 0 - 0				
					$+e^{-iQ}$	***	
			•	•	4		
,						in the second of	
					14 de 15		
						e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
			· ·				
							,
	in the second of	•			en e	10 - .	
				e salah			
				. •			
	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1			and the second s		en e	
	•		*↓ \$			ू हर्दश्येत इंटरकेट	
		•				Market Brown Commence of the C	٠.
				i jeda			

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-181386 (P2001-181386A)

(43)公開日 平成13年7月3日(2001.7.3)

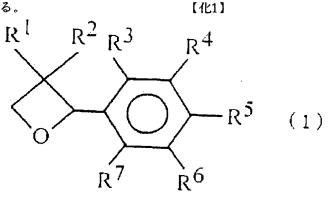
(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマュート*(参考)
C08G 65/18		C 0 8 G 65/18	4J005
65/22		65/22	4 J 0 3 8
// C09D 4/00		C 0 9 D 4/00	
5/00		5/00	С
171/02		171/02	•
		•	請求項の数3 OL (全7 頁)
(21)出願番号	特願平11-372651	(71) 出願人 0000030	34
		東亞合成	C株式会社
(22)出願日	平成11年12月28日(1999.12.28)	東京都洛	医医断槽 1丁目14番 1号
		(72)発明者 加藤 ク	、雄
		愛知県名	名古屋市港区船見町1番地の1 東
		亞合成#	大式会社名古屋総合研究所内
		(72)発明者 佐々木	裕
		愛知県名	名古屋市港区船見町1番地の1 東
		亞 合成核	《式会社名古屋総合研究 所内
		(72)発明者 栗山 昇	t
		愛知県名	る古屋市港区船見町1番地の1 東
		1	大式会社名古屋総合研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 活性エネルギー線カチオン硬化型組成物

(57)【要約】

【課題】本発明の課題は、オキシラン環を有する化合物を使用することなく、短時間の活性エネルギー線照射により、速やかに重合する活性エネルギー線カチオン硬化型組成物を提供することである。

【解決手段】下記式(1)で表されるオキセタン化合物(A)、および活性エネルギー線の照射によりカチオン重合を開始させる化合物(B)からなる活性エネルギー線カチオン硬化型組成物。



(式中、R¹およびR²はそれぞれ水素原子、フッ素原子、炭素数1~6個のアルキル基、炭素数1~6個のフルオロアルキル基、アリル基、アリール基またはフリル

基を示す。 $R^3 \sim R^7$ はそれぞれ水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ 個のアルキル基または炭素数 $1 \sim 6$ 個のアルコキシ基を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記式(1)で表されるオキセタン化合物(A)、および活性エネルギー線の照射によりカチオン

重合を開始させる化合物 (B) からなる活性エネルギー 線カチオン硬化型組成物。

【化1】

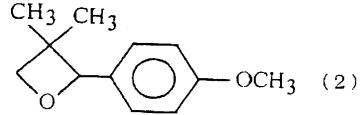
(式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim6$ 個のアルキル基、炭素数 $1\sim6$ 個のフルオロアルキル基、アリル基、アリール基またはフリル基を示す。 $R^3\sim R^7$ はそれぞれ水素原子、炭素数 $1\sim6$ 個のアルキル基または炭素数 $1\sim6$ 個のアルコキシ基を示す。)

【請求項2】前記成分(A)および前記成分(B)の他

に、さらに(C)オキセタン環を有する化合物を含む請求項1記載の活性エネルギー線カチオン硬化型組成物。

【請求項3】前記成分(A)が下記式(2)で表される 2-(4-メトキシフェニル)-3.3-ジメチルオキ セタンである、請求項1または請求項2記載の活性エネ ルギー線カチオン硬化型組成物。

【化2】



【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は活性エネルギー線カ チオン硬化型組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術およびその問題点】4員環環状エーテルであるオキセタン環を重合性官能基として有するオキセタン化合物を用いた場合の光硬化速度は、3員環環状エーテルであるオキシラン環を有するエポキシ樹脂の光硬化速度と比較して速いものの、アクリル系の活性エネルギー線ラジカル重合との比較では、遥かに遅いことが知られている。このため、オキセタン環の様な環状エーテルを重合性基とする光硬化型樹脂は、良好な耐熱性、接着性および耐薬品性を有しているが、速やかな光硬化が必要な用途に使用することが困難であった。オキセタン化合物の光硬化速度を速くする方法として特許公報第2679586号に記載された方法が公知の事実として存在する。しかし、該方法は、オキセタン環を有する化合物と活性エネルギー線の照射によりカチオン重合を開始させる化合物以外に、分子中に1個以上のオキシラン環を

有する化合物を必須成分とするものであり、オキシラン 環を有する化合物を使用せずに、速やかな光硬化が必要 な用途にオキセタン化合物を使用することは困難であっ た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、オキシラン環を有する化合物を使用することなく、短時間の活性エネルギー線照射により速やかに重合する活性エネルギー線カチオン硬化型組成物を提供することである。 【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を解決するため鋭意検討した結果、特定な構造であるオキセタン化合物を使用することで上記課題を解決することを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、下記式(1)で表されるオキセタン化合物(A)および活性エネルギー線の照射によりカチオン重合を開始させる化合物(B)からなる活性エネルギー線カチオン硬化型組成物である。

[0005]

【化3】

【0006】(式中、R1およびR2はそれぞれ水素原 子、フッ素原子、炭素数1~6個のアルキル基、炭素数 1~6個のフルオロアルキル基、アリル基、アリール基 またはフリル基を示す。R3~R7はそれぞれ水素原子、 炭素数1~6個のアルキル基または炭素数1~6個のア ルコキシ基を示す。) 以下、本発明について、さらに詳 しく説明する。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明のおける(A)オキセタン 化合物は前記式(1)で表される化合物であり、前記式 (1)におけるR¹およびR²はそれぞれ水素原子、フッ 素原子、メチル基、エチル基、プロピル基およびブチル

基等の炭素数1~6個のアルキル基、炭素数1~6個の フルオロアルキル基、アリル基、アリール基またはフリ ル基を示す。また、R3~R7はそれぞれ水素原子、メチ ル基、エチル基、プロピル基およびブチル基等の炭素数 1~6個のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロ ポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~6個のアルコキシ 基を示す。前記オキセタン化合物の中でも、得られる組 成物の硬化速度の面から、下記式(2)で表される2-(4-メトキシフェニル)-3,3-ジメチルオキセタ ンが好ましい。

[0008] 【化4】

$$CH_3$$
 CH_3 OCH_3 (2)

【0009】(B)活性エネルギー線の照射によりカチ オン重合を開始させる化合物(以下、活性エネルギー線 カチオン重合開始剤という)としては、後述するような 公知の多種多様なカチオン性光重合開始剤を用いること ができる。これらの開始剤の中でも、好ましいものは、 ジアリールヨードニウム塩およびトリアリールスルホニ ウム塩である。典型的な光重合開始剤を以下の一般式に 示す。

$$\mathbb{R}^{10} \longrightarrow \mathbb{I}^+ \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$\mathbb{M}X_{k+1}$$
(3)

$$\begin{bmatrix} R^{11} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} & & & \\ & & & \\ & & & \\ S^{+} & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ \end{bmatrix}_{2}^{MX_{k+1}} + \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & &$$

上記式(3)~(6)において、R10は水素原子、炭素

【化6】

[0012]

【化7】

[0013]

【化8】

$$S^{+} \left[\begin{array}{c} MX_{k+1} \\ R^{11} \end{array} \right]_{2}$$
 (6)

数1~18個のアルキル基または炭素数1~18個のア

ルコキシ基等であり、R11は水素原子、ヒドロキシアルキル基またはヒドロキシアルコキシ基であり、好ましくはヒドロキシエトキシ基である。Mは金属または半金属を示し、好ましくはアンチモン原子およびリン原子である。また、Xはハロゲン原子、好ましくはフッ素原子である。kは金属の価数を示し、例えばアンチモン原子の場合は5である。

【0014】上記式(3)~(6)で表される化合物を 具体的に例示すれば、以下の化合物が挙げられる。

 $4, 4' - \forall \lambda \{ \emptyset (\beta - \forall \beta + \forall \lambda + \gamma + \gamma + \gamma \} \}$ ルスルフォニオ > フェニルスルフィドービス-ヘキサフ ルオロホスフェート、4-(4-ベンゾイルーフェニル チオ)フェニルージー(4-フルオロフェニル)スルホ ニウムヘキサフルオロホスフェート、4,4'ービス **{ジ(β-ヒドロキシエトキシ)フェニルスルフォニ** オ}フェニルスルフィドービスーヘキサフルオロホスフ ェート、4, 4'ービス {ジ(β-ヒドロキシエトキ シ) フェニルスルホニオ) フェニルスルフィドービスー ヘキサフルオロアンチモネート、4,4'ービス(ジフ ルオロフェニルスルホニオ)フェニルスルフィドービス ーヘキサフルオロホスフェート、4,4'ービス(ジフ ルオロフェニルスルホニオ)フェニルスルフィドービス -ヘキサフルオロアンチモネート、4,4'-ビス(フ ェニルスルホニオ)フェニルスルフィドービスーヘキサ フルオロホスフェート、4,4'ービス(フェニルスル ホニオ)フェニルスルフィドービスーヘキサフルオロア ンチモネート、4-(4-ベンゾイルフェニルチオ)フ ェニルージー (4-(β-ヒドロキシエトキシ)フェニ ル〉スルホニウムヘキサフルオロホスフェート、4-(4-ベンゾイルフェニルチオ)フェニルージー (4-(β-ヒドロキシエトキシ) フェニル} スルホニウムへ キサフルオロアンチモネート、4-(4-ベンゾイルフ ェニルチオ)フェニルージー(4-フルオロフェニル) スルホニウムヘキサフルオロホスフェート、4-(4-ベンゾイルフェニルチオ)フェニルージー(4-フルオ ロフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアンチモネー ト、4-(4-ベンゾイルフェニルチオ)フェニルージ フェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、4 - (4-ベンゾイルフェニルチオ)フェニルージフェニ ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4-(フェニルチオ) フェニルージー (4-(β-ヒドロキ シエトキシ)フェニル}スルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、4-(フェニルチオ)フェニルージー {4 - (β-ヒドロキシエトキシ)フェニル}スルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4~(フェニルチオ) フェニルージー (4ーフルオロフェニル) スルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-(フェニルチオ)フ ェニルージー(4-フルオロフェニル)スルホニウムへ キサフルオロアンチモネート、4-(フェニルチオ)フ ェニルージフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフ

ェート、4-(フェニルチオ)フェニルージフェニルス ルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4-(2-クロロー4 ーベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フルオロフェニル) スルホニウムヘキサフルオロ ホスフェート、4-(2-クロロ-4-ベンゾイルフェ ニルチオ)フェニルビス(4-フルオロフェニル)スル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4-(2-2 ロロー4ーベンゾイルフェニルチオ)フェニルジフェニ ルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、4-(2 ークロロー4ーベンゾイルフェニルチオ)フェニルジフ ェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4 - (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ)フェニ ルビス (4 – ヒドロキシフェニル) スルホニウムヘキサ フルオロホスフェート、4-(2-クロロー4-ベンゾ イルフェニルチオ)フェニルビス(4-ヒドロキシフェ ニル)スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ト リフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、 トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー ト、(トリルクミル) ヨードニウムヘキサフルオロホス フェート、(トリルクミル) ヨードニウムヘキサフルオ ロアンチモネート、(トリルクミル) ヨードニウムテト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、ビス (タ ーシャリブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロ ホスフェート、ビス (ターシャリブチルフェニル) ヨー ドニウムヘキサフルオロアンチモネート、ビス (ターシ ャリブチルフェニル) ヨードニウムテトラキス (ペンタ フルオロフェニル) ボレート、ベンジルー4-ヒドロキ シフェニルメチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェ ート、ベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート、ベンジルジメチ ルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、ベンジル ジメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、 p-クロロベンジル-4-ヒドロキシフェニルメチルス ルホニウムヘキサフルオロホスフェート、p-クロロベ ンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへ キサフルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニル ジメチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、4 -アセトキシフェニルジメチルスルホニウムヘキサフル オロアンチモネート、4ーメトキシカルボニルオキシフ ェニルジメチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェー ト、4-メトキシカルボニルオキシフェニルジメチルス ルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、4-エトキ シカルボニルオキシフェニルジメチルスルホニウムヘキ サフルオロホスフェート、4-エトキシカルボニルオキ シフェニルジメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、αーナフチルメチルジメチルスルホニウムへ キサフルオロホスフェート、αーナフチルメチルジメチ ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、αーナ フチルメチルテトラメチレンスルホニウムヘキサフルオ ロホスフェート、αーナフチルメチルテトラメチレンス

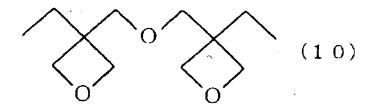
ルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、シンナミル ジメチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、シ ンナミルジメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモ ネート、シンナミルテトラメチレンスルホニウムヘキサ フルオロホスフェート、シンナミルテトラメチレンスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、N-(α-フ ェニルベンジル) -2-シアノピリジニウムヘキサフル オロホスフェート、 $N-(\alpha-フェニルベンジル)-2$ ーシアノピリジニウムヘキサフルオロアンチモネート、 N-シンナミル-2-シアノピリジニウムヘキサフルオ ロホスフェート、Nーシンナミルー2ーシアノピリジニ ウムヘキサフルオロアンチモネート、N-(α-ナフチ ルメチル) -2-シアノピリジニウムヘキサフルオロホ スフェート、 $N-(\alpha-t)$ フチルメチル)-2-シアノ ピリジニウムヘキサフルオロアンチモネート、N-ベン ジルー2-シアノピリジニウムヘキサフルオロホスフェ ート、N-ベンジルー2-シアノピリジニウムヘキサフ ルオロアンチモネートなど。

【0015】上記活性エネルギー線カチオン重合開始剤は、活性エネルギー線カチオン硬化型組成物の全量100重量部に対して、0.2~10重量部使用することが好ましく、0.5~5重量部使用することがさらに好ましい。開始剤の使用量が0.2重量部未満では重合が進

行し難く、10<u>重量</u>部を越えると硬化物の柔軟性に劣る。

【0016】本発明における組成物には、上記(A)成 分および(B)成分の他に、さらに(C)成分として (A) 成分以外のオキセタン環を有する化合物を含むこ とが好ましい。(C)成分としては分子中に1個以上の オキセタン環を有する化合物であれば特に限定なく使用 できる。具体的には特開平8-85775号公報および 特開平8-134405号公報等に記載された各種のオ キセタン化合物が挙げられる。具体例を挙げれば、分子 中にオキセタン環を1個有するオキセタン化合物として は、下記式(7)で表される3-エチルー3-(フェノ キシメチル) オキセタン、下記式(8)で表される3-エチルー3-(2-エチルヘキシロキシメチル)オキセ タン、下記式(9)で表される3-エチル-3-(ヒド ロキシメチル) オキセタン等が挙げられる。また、分子 中にオキセタン環を2個有する化合物としては、下記式 (10)で表されるビス(3-エチル-3-オキセタニ ルメチル) エーテル、下記式(11)で表される1,4 ービス({(3-エチルー3-オキセタニル)メトキ

【0017】 【化9】



【0021】 【化13】

【0022】本発明における硬化型組成物には、上記以 外に、3員環環状エーテルであるオキシラン環を有する エポキシ化合物を配合することができる。エポキシ化合 物としては、3、4ーエポキシシクロヘキシルメチルー 3,4-エポキシシクロヘキシルカルボキシレート(ユ ニオンカーバイト社製)およびビスー(3,4-エポキ シシクロヘキシル)アジペート(ユニオンカーバイト社 製)などの脂環式エポキシ化合物、エチレングリコール のジグリシジルエーテル、プロピレングリコールのジグ リシジルエーテルおよび1.6-ヘキサンジオールのジ グリシジルエーテルなどの脂肪族エポキシ化合物、なら びにビスフェノールAのグリシジルエーテルおよびノボ ラック樹脂やクレゾール樹脂のエピクロルヒドリン変性 物などの芳香族エポキシ化合物などが挙げられる。エポ キシ化合物の使用量は、オキセタン化合物100重量部 に対して5~95重量部であることが好ましい。また、 その他の成分として、無機充填剤、染料、顔料、粘度調 節剤、処理剤および紫外線遮断剤などを配合することが できる。

[0023]

【実施例】以下、実施例および比較例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。(A)成分として前記式(2)で表される2-(4-メトキシフェニル)-3,3-ジメチルオキセタンを使用した。この化合物の合成方法を以下に示す。

Hu Xianming, Richard M. Kellogg, J. Synthesis 199 5. 533-538頁に記述されている方法を用いて、2-(4-x)+キシフェニル)-3, 3-ジメチルオキセタンの合成を行った。その後、得られた2-(4-x)+キシフェニル)-3, 3-ジメチルオキセタン溶液を水素化カルシウム存在下で減圧蒸留し、高純度の2-(4-x)+キシフェニル)-3, 3-ジメチルオキセタンを得た。【0024】実施例1

(A) 成分として上記の方法で合成した2-(4-メトキシフェニル)-3,3-ジメチルオキセタンを100

部(重量部、以下同じ)、および(B)成分としてUV I-6990 {ユニオン・カーバイド日本(株)社製} 2部を混合して活性エネルギー線硬化型組成物を調製した。

【0025】○硬化性

表面をクロメート処理されたアルミ板に調製した組成物を約20 μ mになるように塗布した後、120W/cmの高圧水銀灯を設置したコンベアタイプの紫外線照射装置(照射強度:296mW/cm²(80W/cm、ランプ高さ=10cm)、積算エネルギー:85.0mJ/cm²(80W/cm、ランプ高さ=10cm、コンベアスピード10m/min.)}を用い、組成物を塗布したアルミ板をコンベアに乗せ、コンベアスピードを変化させて、組成物の表面から粘りがなくなる最大スピードを測定し、これを硬化性の評価とした。その結果を下記表1に示す。

【0026】〇密着性

得られた硬化膜を、1mm間隔で碁盤目に切り込みを入れ、JISK5400に記載の方法で密着性を評価した。なお、表1における \bigcirc 、 \triangle および \times は以下の状況を意味する。

○: ほとんど剥がれ無し、△:50%以上残る、×:50%を超えて剥がれる

【0027】実施例2~5

(A) 成分として2-(4-メトキシフェニル)-3, 3-ジメチルオキセタン、(B) 成分としてUVI-6 990、(C) 成分として前記式(10) または前記式(11) で表されるオキセタン化合物を使用し、表1に示した組成で混合して活性エネルギー線硬化型組成物を調製した。調製した組成物について実施例1と同様に評価を行い、その結果を表1に示す。

【0028】比較例1~3

(B)成分としてUVI-6990、(C)成分として前記式(10)または前記式(11)で表されるオキセタン化合物を使用し、表1に示した組成で混合して活性エネルギー線硬化型組成物を調製した。得られた組成物について実施例1と同様に評価を行い、その結果を表1に示す。

[0029]

【表1】

【表1】

実施例	(A)	(A) (B) (C)		硬化性	mb ab i	
×16.71	[重量部]	[重量部]	[重量部]	m/min.	密着性	
1	式 (2) の	UVI-6990		60 以上	0	
	化合物	[2]		00 2	1	
ļ	[100]			1	j .	
2	式(2)の	间上	式 (10) の	60 以上	0	
	化合物	[2]	化合物	0.0.1		
 	[20]	 	[80]			
3	式 (2) の	同上	式 (10) の	60以上	0	
	化合物	[2]	化合物		•	
	[40] 式(2)の		[60]			
4	化合物	同上	式(11)の	60以上	0	
	[20]	[4]	化合物	ľ		
	式 (2) の	间上	【80】	 		
5	化合物	[4]	八(エコ)の	60 以上	0	
	[40]	(7)	[60]			
比較例			(00)		·	
足吸納						
1	_	UVI-6990	式(10)の	F (2) T		
_		[2]	化合物	5以下	-	
			[100]		ľ	
2	_	同上:	式 (10) の	5	0	
		[4]	化合物	J	ا ک	
			[100]			
3	-	间上	式 (11) の	5	0	
1		. [4]	化合物	-]	Ŭ	
			[100]			

[0030]

【発明の効果】本発明の活性エネルギー線硬化型組成物は、紫外線または電子線等の活性エネルギー線照射により速やかに硬化し、かつ、密着性に優れた性質を有する

ものであるため、塗料・コーティング剤、フィルム・シート状材料、成形材料および接着剤などに好適に利用することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J005 AA07 AA09 BA00 BB01 BB02 4J038 DF021 KA03 NA12 NA23 PA17 PC02 THIS PAGE BLANK (USPTO)